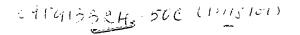
PATENT COOPERATION TREATY

	From the INTERNATIONAL BUREAU				
PCT	То:				
NOTIFICATION OF THE RECORDING OF A CHANGE (PCT Rule 92bis.1 and Administrative Instructions, Section 422)	DEMENTIEV, Vladimir Nikolaevich Prechistensky per., 14-1 14-y etazh Moscow, 119034 FÉDÉRATION DE RUSSIE				
Date of mailing (day/month/year) 30 October 2000 (30.10.00)					
Applicant's or agent's file reference	IMPORTANT NOTIFICATION				
International application No. PCT/RU99/00037	International filing date (day/month/year) 11 February 1999 (11.02.99)				
The following indications appeared on record concerning: the applicant	X the agent the common representative				
Name and Address DEMENTIEV, Vladimir Nikolaevich B.Palashevsky per., 3, office 2 Moscow, 103104 Russian Federation	State of Nationality Telephone No. 203 20 62 Facsimile No. 935 57 87 Teleprinter No.				
2. The International Bureau hereby notifies the applicant that the the person the name X the add					
Name and Address DEMENTIEV, Vladimir Nikolaevich Prechistensky per., 14-1 14-y etazh Moscow, 119034 Russian Federation 3. Further observations, if necessary:	State of Nationality Telephone No. 787 20 70 Facsimile No. 787 20 71 Teleprinter No.				
3. Further observations, il necessary.					
4. A copy of this notification has been sent to: X the receiving Office the International Searching Authority the International Preliminary Examining Authority	the designated Offices concerned the elected Offices concerned other:				
The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland Facsimile No.: (41-22) 740.14.35	Authorized officer Beatriz Morariu Telephone No.: (41-22) 338 83.38				





PALENT COOPERATION TREAT

To:

From the INTERNATIONAL BUREAU

PCT

NOTIFICATION OF ELECTION

(PCT Rule 61.2)

Commissioner **US Department of Commerce United States Patent and Trademark** Office, PCT 2011 South Clark Place Room CP2/5C24

Arlington, VA 22202 **ETATS-UNIS D'AMERIQUE**

in its capacity as elected Office

Date of mailing (day/month/year) 27 September 2001 (27.09.01)

International application No. PCT/US00/03505

International filing date (day/month/year) 11 February 2000 (11.02.00)

P602MCP-PCT

Priority date (day/month/year)

Applicant's or agent's file reference

11 February 1999 (11.02.99)

Applicant

PERRY, Michael, C.

1.	The designated Office is hereby notified of its election made:
	X in the demand filed with the International Preliminary Examining Authority on:
	07 September 2000 (07.09.00)
	in a notice effecting later election filed with the International Bureau on:
2.	The election X was
	was not
	made before the expiration of 19 months from the priority date or, where Rule 32 applies, within the time limit under Rule 32.2(b).

The International Bureau of WIPO 34, chemin des Colombettes 1211 Geneva 20, Switzerland

Authorized officer

Claudio BORTON

Telephone No.: (41-22) 338.83.38

Facsimile No.: (41-22) 740.14.35

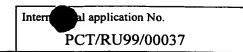
THIS PAGE BLANK (USPTO)

PCT Apple 25 TO THE TOO PERATION TREATY PCT Apple 25 TO THE PORT OF THE PORT

Applicant's or agent's file reference	FOR FURTHER ACTI		cation of Transmittal of International Examination Report (Form PCT/IPEA/416)			
International application No.	International filing date (lay/month/year)	Priority date (day/month/year)			
PCT/RU99/00037	11 February 1999	(11.02.99)				
International Patent Classification (IPC) or national classification and IPC C23C 16/32, 16/452, B23B 15/00						
Applicant	HARDIDE LI	MITED				
 This international preliminary examination report has been prepared by this International Preliminary Examining Authority and is transmitted to the applicant according to Article 36. This REPORT consists of a total of						
7 This are a south in a indications role	ting to the following items:					
3. This report contains indications rela						
Basis of the report						
II Priority	20 11 11 11 11 11 11		A Company of the Comp			
I "" ' <u> </u>		iovelty, inventive	step and industrial applicability			
IV Lack of unity of ir		1 16	the second secon			
	V Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement					
VI Certain documents	VI Certain documents cited					
VII Certain defects in the international application						
VIII Certain observation	VIII Certain observations on the international application					
Date of submission of the demand Date of completion of this report						
Date of submission of the demand		_	-			
02 September 2000 (02	.09.00)	23	May 2001 (23.05.2001)			
Name and mailing address of the IPEA/RU	A	nthorized officer				
Facsimile No.	Te	Telephone No.				

THIS PAGE BLANK (USPTO)

INTERNATIONAL PRELIMINARY EXAMINATION REPORT



I. Basis of the report							
1. This report has been drawn on the basis of (Replacement sheets which have been furnished to the receiving Office in response to an invitation under Article 14 are referred to in this report as "originally filed" and are not annexed to the report since they do not contain amendments.):							
\boxtimes	the international application as originally filed.						
	the description,	pages	_, as originally filed,				
		pages	_, filed with the demand,				
		pages	_, filed with the letter of,				
		pages	_, filed with the letter of				
	the claims,	Nos	_ , as originally filed,				
		Nos.	, as amended under Article 19,				
		Nos.	_, filed with the demand,				
		Nos	_ , filed with the letter of ,				
		Nos.	_ , filed with the letter of				
	the drawings,	sheets/fig	_ , as originally filed,				
		sheets/fig	_ , filed with the demand,				
		sheets/fig	_ , filed with the letter of ,				
		sheets/fig	_ , filed with the letter of				
2. The amen	dments have result	ed in the cancellation of:					
	the description,	pages					
	the claims,	Nos					
	the drawings,	sheets/fig					
			•				
3. Thi	is report has been e go beyond the discl	stablished as if (some of) the an osure as filed, as indicated in the	nendments had not been made, since they have been considered e Supplemental Box (Rule 70.2(c)).				
4. Additiona	d observations, if n	ecessary:					

THIS PAGE BLANK (USPTO)

INTERNATIONAL PRELIMARY EXAMINATION REPORT

V. Reasoned statement under Article 35(2) with regard to novelty, inventive step or industrial applicability; citations and explanations supporting such statement

Statement			
Novelty (N)	Claims	1-90	YES
	Claims		NO NO
Inventive step (IS)	Claims	1-90	YES
	Claims		NO
Industrial applicability (IA)	Claims	1-90	YES
	Claims		NO

2. Citations and explanations

Claims 1-6, 7, 8-12, 51-55, 56-66, 67-69, 76-80, 81-86 and 87-90 meet the criteria of novelty and inventive step since the prior art does not disclose materials for coatings and wear-resistant coatings comprising fluorine-doped tungsten carbide. These materials exhibit increased hardness and a stabilized structure.

Claims 13-30 meet the criteria of novelty and inventive step since the prior art does not disclose methods of obtaining fluorine-doped tungsten carbides according to which carbon-containing gas is activated by heating to a temperature of 500-580 DEG C before being fed into a reactor.

Claims 31-50 and 70-75 meet the criteria of novelty and inventive step since the prior art does not disclose methods of applying coatings according to which a layer of material containing fluorine-doped tungsten carbide is applied.

THIS PAGE BLANK (USPTO)

PCT

ВСЕМИРНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Международное бюро



МЕЖДУНАРОДНАЯ ЗАЯВКА, ОПУБЛИКОВАННАЯ В СООТВЕТСТВИИ С ДОГОВОРОМ О ПАТЕНТНОЙ КООПЕРАЦИИ (РСТ)

(51) Международная классификация WO 00/47796 (11) Номер международной публикации: изобретения ⁷: (43) Дата международной публикации: **A1** C23C 16/32, 16/452, B23B 15/00 17 августа 2000 (17.08.00)

(21) Номер международной заявки:

PCT/RU99/00037

(22) Дата международной подачи:

11 февраля 1999 (11.02.99)

- (71) Заявитель (для всех указанных государств, кроме (US): ISLE HARDING LTD. [GB/GB]; Prospect Chambers, Prospect Hill, Douglas, Isle of Man, IM1 2PT (GB).
- (72) Изобретатели; и
- (75) Изобретатели/Заявители (только для (US): ЛАХОТ-КИН Юрий Викторович [RU/RU]; 127474 Москва, ул. Селигерская, д. 10/1, кв. 63 (RU) [LAKHOTKIN, Jury Viktorovich, Moscow (RU)]. КУЗЬМИН Владимир Петрович [RU/RU]; 117574 Москва, ул. Голубинская, д. 19, кв. 142 (RU) [KUZMIN, Vladimir Petrovich, Moscow (RU)]
- ДЕМЕНТЬЕВ Владимир Николаевич; 103104 (74) Агент: Москва, Б.Палашевский пер., д. 3, офис 2 (RU) [DEMENTIEV, Vladimir Nikolaevich, Moscow (RU)].

(81) Указанные государства: AL, AM, AU, BB, BG, BR, BY, CA, CN, CZ, EE, FI, GE, HU, IS, JP, KE, KG, KP, KR, LK, LR, LS, LV, MD, MG, MK, MN, MW, MX, NO, NZ, PL, RO, RU, SD, SG, SI, SK, TR, TT, UA, UG, US, UZ, VN, европейский патент (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), евразийский патент (АМ, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM).

Опубликована

С отчётом о международном поиске.

- (54) Title: TUNGSTEN CARBIDE COATINGS AND METHOD FOR PRODUCING THE SAME
- (54) Название изобретения: КАРБИДОВОЛЬФРАМОВЫЕ ПОКРЫТИЯ И СПОСОБ ИХ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

(57) Abstract

The present invention relates to new tungsten carbides which are doped with fluorine in an amount of up to 0.5 wt % and which can also be doped with fluorocarbon compositions. These tungsten carbides are produced according to a new CVD method in which the phase contains tungsten hexafluoride, hydrogen and a carbon-containing gas. This method is characterised in that the carboncontaining gas is previously thermally activated. The tungsten carbide coatings can be applied onto construction material and articles made therefrom. These coatings exhibit a high wear and corrosion resistance as well as a high chemical stability.

(54) Реферат

Описаны новые карбиды вольфрама, легированные фтором в количестве до 0,5 вес. %, и возможно фторуглеродными композициями. Их получение возможно новым способом химического газофазного осаждения, включающей гексафторид вольфрама, водорода и углеродсодержащего газа. Особенностью нового способа является предварительная термическая активация углеродсодержащего газа.

Карбидовольфрамовые покрытия наносятся на конструкционные материалы и изделия из них. Они имеют повышенные износостойкость, коррозионную и химическую стойкость.

IAICIV-INTO-INVILLE-INTO VERO TE PINT I DRE-INTERNITA DE LA COLLEGIA DEL COLLEGIA DE LA COLLEGIA DE LA COLLEGIA DEL COLLEGIA DE LA COLLEGIA DEL COLLEGIA DE LA COLLEGIA DE LA COLLEGIA DE LA COLLEGIA DE LA COLLEGIA DEL COLLEGIA DE LA COLLEGIA DEL COLLEGIA DEL COLLEGIA DE LA COLLEGIA DE LA COLLEGIA DE LA COL

Коды, используемые для обозначения стран-членов РСТ на титульных листах брошюр, в которых публикуются международные заявки в соответствии с РСТ.

1							
AL	Албания	ES	Испания	LS	Лесото	SK	Словакия
AM	Армения	FI	Финляндия	LT	Литва	SN	Сенегал
AT	Австрия	FR	Франция	LU	Люксембург	SZ	Свазиленд
AU	Австралия	GA	Габон	LV	Латвия	TD	Чад
AZ	Азербайджан	GB	Великобритания	MC	Монако	TG	Того
BA	Босния и Герцеговина	GE	Грузия	MD	Республика Молдова	ТJ	Таджикистан
BB	Барбадос	GH	Гана	MG	Малагаскар	TM	Туркменистан
BE	Бельгия	GN	Гвинея	MK	бывшая югославская	TR	Турция
BF	Буркина-Фасо	GR	Греция		Республика Македония	TT	Тринидад и Тобаго
BG	Болгария	HU	Венгрия	ML	Мали	UA	Украина
BJ	Бенин	IE	Ирландия	MN	Монголия	UG	Уганда
BR	Бразилия	IL	Израиль	MR	Мавритания	US	Соединённые Штаты
BY	Беларусь	IS	Исландия	MW	Малави		Америки
CA	Канада	IT	Италия	MX	Мексика	UZ	Узбекистан
CF	Центрально-Африкан-	JP	Япония	NE	Нигер	VN	Вьетнам
	ская Республика	KE	Кения	NL	Нидерланды	YU	Югославия
CG	Конго	KG	Киргизстан	NO	Норвегия	zw	Зимбабве
CH	Швейцария	KP	Корейская Народно-	NZ	Новая Зеландия		
CI	Кот-д'Ивуар		Демократическая Рес-	PL	Польша		
CM	Камерун		публика	PT	Португалия		
CN	Китай	KR	Республика Корея	RO	Румыния		
CU	Куба	KZ	Казахстан	RU	Российская Федерация		
CZ	Чешская Республика	LC	Сент-Люсия	SD	Судан		
DE	Германия	LI	Лихтенштейн	SE	Швеция		
DK	Дания	LK	Шри Ланка	SG	Сингапур		
EE	Эстония	LR	Либерия	SI	Словения		

WO 00/47796 PCT/RU99/00037

КАРБИДОВОЛЬФРАМОВЫЕ ПОКРЫТИЯ И СПОСОБ ИХ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

Область техники

- 5 Изобретение относится к технологии нанесения композиционных поверхностных систем, обладающих высокой износо-, эрозионно- и химической стойкостью. Более точно, изобретение относится к технологии нанесения покрытий, которые включают карбиды вольфрама, их смеси между собой, с вольфрамом или со свободным углеродом.
- Особотвердые, эрозионно- и коррозионностойкие покрытия, в том числе с использованием карбидов вольфрама, широко используются для изготовления различных изделий и инструментов в современном машиностроении. Такие покрытия обладают высокой эрозионной, химической и износостойкостью, и таким образом существенно повышают
 срок службы различных изделий машиностроения и инструментов, работающих в жестких эксплуатационных условиях.

Уровень техники

- В патенте GB 2 179 678 А описана поверхностная композитная система с высокой износо-, и эрозионной стойкостью, состоящая из смеси вольфрама для обеспечения пластичности и карбида вольфрама W₂C для обеспечения твердости. Эти твердые покрытия из мелкозернистой смеси карбида вольфрама с металлическим вольфрамом были получены методом физического газофазного осаждения (PVD), путем распыления вольфрама и углерода, содержащихся в отдельных мишенях. На подложках различного типа вольфрам и углерод конденсируются, образуя названные сплавы вольфрама с карбидом вольфрама.
- Однако, скорость синтеза карбидов вольфрама очень низка, внутренние напряжения в осадках резко возрастают по мере роста вольфрам-углеродного слоя, что приводит к отслаиванию покрытия. По этой причине получить

достаточно толстые покрытия PVD-методом не удается. Кроме того, метод физического газофазного осаждения принципиально не пригоден для нанесения покрытий на изделия сложной геометрии из-за невозможности осаждения покрытий на затененных по отношению к падающему пучку

5 участках изделия.

Процесс химического газофазного осаждения (CVD) исключает эти недостатки. CVD-процесс может быть использован для нанесения абразивно, эрозионно- и износостойких, твердых покрытий на подложках и изделиях сложной геометрии.

В типичном CVD процессе нанесения композитных покрытий подложка нагревается в реакционной камере и затем предварительно смешанные газообразные реагенты вводятся в эту камеру. Изменением состава реакционной смеси и параметров процесса (температура подложки, состав реакционной смеси, скорость потока, общее давление в реакционной смеси, температура подаваемых газов и т.д.) могут быть получены различные

покрытия.

Среди CVD-методов осаждения—w-С-покрынии полько фиорилизм засселозволяет формировать карбиды вольфрама высокого качества при низкой температуре. Для этого в CVD процессе используют термическое разложение смеси гексафторида вольфрама, водорода и углеродсодержащего газа.

В качестве углеродсодержащих газов использовались различные реагенты, например, диметилэфир, амины, пропилен и т.д., с помощью которых можно синтезировать карбид вольфрама одного или двух составов.

Например, при помощи термического разложения диметилэфира (DME) 25 [ЕП 0 328 084 ВІ] получены смеси W+W₃C; W+W₂C+W₃C; W+W₂C в виде двухслойных покрытий. Вольфрамовый внутренний слой покрытия получен из газовой смеси WF₆ (0,3 л/мин), Н₂ (3 л/мин), Ar (4,0 л/мин) при 460°C. Внешний слой из смеси вольфрама с W₃C получен из смеси WF₆ (0,3 л/мин), H₂ (3 л/мин) и DME (0,4 л/мин) при 460°C и общем давлении 30 40 тор. Внешнее покрытие W+W₂C+W₃C получено из смеси WF₆ (0,3 л/мин), H₂ (3 л/мин) и DME (0,55 л/мин) при 460°C и общем давлении

40 тор. Внешнее покрытие W+W₂C получено из смеси WF₆ (0,3 л/мин), H₂ (3 л/мин), Ar (4,5 л/мин) и DME (0,85 л/мин) при 460°C и общем давлении 40 тор.

По патенту JP 9113527 А 19910204 из газообразной смеси WF_6 , H_2 и аминов с атомным соотношением С к N равным 1-20 и H к W равным 1-15 при 400-900 \circ C получен WC. Приведено получение WC из смеси WF_6 :триметиламин: H_2 =1:2:3 (атомное соотношение C/W=6,0, H/W=6,0), скорость потока 120 см³/мин при 800 \circ C, атмосферном общем давлении, в течение 30 мин в виде слоя толшиной 70 микрон.

По патенту ЈР 8857301 А 19880310 из газообразной смеси WF₆, H и ароматического углеводорода с атомным соотношением C/W равном 2-10 и H/C более 3 при температуре 250-500 $^{\circ}$ C получено покрытие из W₃C на подложке из алюминия.

Согласно патенту JP 84280063 A 19841228 из газообразной смеси WF₆, C_3H_6 и H_2 с инертным газом на графитовой подложке получено покрытие из W $\mathcal L$ Преимущественный режим: смесь WF₆: H_2 =1:3-1:15 с добавкой C_3H_6 в реакционной смеси с мольным соотношением 0,01-0,3; температура подложки 350-600 \circ C.

По патенту JP 84204563 A 19840929 из газообразной смеси WF₆, H₂ (мольное соотношение WF₆: H₂=1:3-1:15) и циклопропана с мольным соотношением в смеси 0,01-0,3 при температуре подложки 350-600 $^{\circ}$ С получено покрытие из W₂C. В примере приведено получение покрытия из W₂C на медной подложке из смеси WF₆: 40, H₂: 320, Ar: 40, C₃H₉: 10 см³/мин при 500 $^{\circ}$ С со скоростью роста 3,3 микрона/мин.

В ЕП А 0 305 917 описаны особотвердые, мелкозернистые, нестолбчатые, слоистые вольфрам-углеродные сплавы, которые получены химическим осаждением из газовой фазы. Описанные сплавы содержат карбидные фазы, состоящие их W₂C или W₃C, или из их смеси между собой. Показано, что эти вольфрам-углеродные сплавы, нанесенные на некоторые типы подложек содержат сетку очень тонких микротрещин по всему осадку. Покрытия из этих сплавов обладают недостаточным сопротивлением к эрозии и износу.

В ЕП 0 411 646 AI описано многослойное покрытие, содержащее последовательно чередующиеся слои вольфрама и смеси вольфрама с карбидами вольфрама в виде W_2C , W_3C или их смеси. Показано, что такое покрытие повышает абразивную и эрозионную стойкость материала. Однако известно, что максимальный композиционный эффект наблюдается для слоев с резкой границей между ними. Этого естественно не наблюдается при сопряжении слоев вольфрама и смеси вольфрама с карбидом вольфрама, что характерно для этого патента.

10 Сущность изобретения

Как следует из представленных выше патентов для получения различных видов карбидов вольфрама используются различные реагенты и различные технологии. В связи с этим основной задачей, решаемой настоящим изобретением являлось создание универсальной технологии, позволяющей получать как все известные карбиды, так и их смеси, и более того, новые карбиды.

Кроме того, продолжает оставаться актуальной и задача повышения твердости покрытий W-C, поскольку именно с твердостью связаны такие потребительские характеристики как прочность и износостойкость покрытий. Решение этих и других задач обеспечивается настоящим изобретением благодаря созданию нового способа получения карбидов вольфрама и их смесей, основной особенностью которого является предварительная термическая активация углеводородов, используемых в CVD процессе. Синтез W-C слоя определенного состава зависит от температуры активации, которая варьируется от 500-850∘C, общего давления в реакторе (от 2 до 150 кПа) и парциального давления углеводородного реагента.

Предварительная активация углеводородов приводит к формированию в газовой фазе необходимой концентрации углеводородных радикалов и их ассоциаций со фтором в широком диапазоне. С помощью предложенного способа удается легировать карбиды и/или их смеси фтором и фтор-

углеродными композициями. Фтор, как наиболее химически активный элемент, внедряясь в решетку карбида, усиливает межатомную связь. Усиление межатомной связи в карбиде и приводит к повышению твердости. Этот процесс подобен образованию оксикарбидных фаз, вместо чисто карбидных структур. С другой стороны, фтор стабилизирует структуру низкотемпературных фаз - субкарбидов вольфрама, благодаря высокой энергии связи фтор-углерод.

Наряду с элементарным фтором в состав карбида вольфрама могут быть введены и фторуглеродные композиции с содержанием углерода до 15 вес.% и фтора до 0,5 вес.%. Эти добавки выполняют двоякую роль: во-первых, они повышают твердость карбидов вольфрама и, во-вторых, стабилизируют структуру субкарбидов вольфрама. Таким образом, при помощи введения фтора и фторуглеродных добавок удалось получить карбиды вольфрама, такие как монокарбид WC, полукарбид W_2 C, субкарбиды W_3 C и W_{12} C.

С использованием новых карбидов вольфрама может быть изготовлено двуслойное покрытие, внутренний слой которого (наносимый на подложку - конструктивный материал или изделие из него) выполнен из вольфрама, а наружный слой содержит карбид вольфрама, легированный фтором и, возможно, фторуглеродными композициями или смеси таких карбидов между собой, а также с вольфрамом и со свободным углеродом.

Конструкционный материал с нанесенным композиционным покрытием имеет внутренний слой вольфрама толшиной 0,5-300 мкм, а наружный слой имеет толщину 0,5-300 мкм при соотношении толщин внутреннего и наружного слоев от 1:1 до 1:600.

25

Карбиды вольфрама согласно настоящему изобретению осаждают в химическом реакторе на подложку из газовой фазы, включающей гексафторид вольфрама, водород, углеродсодержащий газ, например, пропан и, необязательно, инертный газ, например, аргон. Углеродсодержащий газ перед вводом в реактор термически активируют путем нагрева до 500-850°C, процесс ведут при давлении в реакторе от 2 до 150 кПа, подложку нагревают

до температуры 400-900°C. Соотношение углеродсодержащего газа к водороду варьируется от 0,2 до 1,7, гексафторида вольфрама к водороду от 0,02 до 0,12.

Параметры процесса в указанных пределах определяются в зависимости от того, какой карбид или смесь карбидов между собой, или с вольфрамом, или с углеродом, необходимо получить. Так, для получения монокарбида вольфрама WC предварительную термоактивацию углеродсодержащего газа проводят при температуре 750-850°C, соотношение пропана к водороду устанавливают в интервале 1,00-1,50, гексафторида вольфрама к водороду -

10 0,08-0,10.

Для получения однофазного полукарбида вольфрама W₂C указанные значения соответственно равняются: 600-750°C, 0,75-0,90 и 0,06-0,08; для получения субкарбида вольфрама W₃C: 560-720°C, 0,60-0,65 и 0,050-0,055. Способом согласно настоящему изобретению был получен и неизвестный ранее субкарбил вольфрама W₁₂C с максимальной твердостью по отношению к известным карбидам, доходящей до 3500 кГ/мм². Для его получения пропан подвержател водова в интервале 0,35-0,40, гексафторида вольфрама к водороду от 0,040 до 0,045.

20 Данный способ позволяет получать и смеси карбидов вольфрама, а также смеси карбидов со свободными вольфрамом и углеродом. Значения указанных параметров для этих случаев приведены в Таблице 1.

30

Таблица 1

	N π/π	Состав	Температура активации пропана •С	Соотношение пропана к водороду	Соотношение гексафторида вольфрама к водороду
1	1.	WC+W ₂ C	670-790	0,90-1,00	0,07 - 0,09
5	2.	W,C+W ₃ C	580-730	0,70-0,75	0,055-0,060
,	3.	W,C+W ₁₂ C	570-700	0,60-0,65	0,045-0,060
	4.	$W_3C+W_{12}C$	550-680	0,40-0,60	0,045-0,050
	5.	W ₂ C+W ₃ C	570-710	0,65-0,70	0,045-0,060
		+W;2C			
10	6.	WC+W	600-720	0,70-0,90	0,08-0,09
10	7.	W ₂ C+W	600-720	0,70-0,90	0,08 - 0,09
	8.	W ₃ C+W	560-700	0,60-0,65	0,055-0,070
	9.	W ₁₂ C+W	500-680	0,20-0,35	0,045-0,070
	10.	$W_3C+W_{12}C$	500-680	0,35-0,60	0,05-0,07
		+W		. 50 4 50	0.10 0.12
15	11.	WC+C	750-850	1.50-1.70	0.10 - 0.12

Как уже указано выше, за счет предварительной термической активации исходного углеродсодержащего реагента осуществляется регулирование содержания активных углеводородных радикалов в широких пределах. Это позволяет формировать карбидные фазы и их смеси с содержанием Термическую активацию вес.% 15 свободного углерода до углеродсодержащего реагента проводят во фтороводородной атмосфере, что способствует дополнительному образованию фторуглеродных радикалов. Радикалы обоих видов участвуют в легировании карбидных фаз и их смесей 25 фтором и углеродом, что способствует повышению их прочностных и триботехнических свойств.

При росте покрытий из однофазных карбидов вольфрама внутренние напряжения в них нарастают медленно и высокая износостойкость этих покрытий наблюдается при достаточно большой толщине (до 300 мкм). Их химическая стойкость и высокая твердость обусловлена сильной межатомной связью атомов в решетке карбидов и отсутствием свободного вольфрама.

Для реализации микропластического эффекта в покрытиях используются смеси карбидов между собой, их смеси с вольфрамом или свободным углеродом, несколько теряя при этом химическую или электрохимическую стойкость. Необходимо отметить, что покрытия из карбидов вольфрама со 5 свободным углеродом, кроме реализации отмеченного микропластического эффекта, имеют пониженный коэффициент трения. Последнее чрезвычайно важно при использовании смесей карбидов со свободным углеродом в качестве износостойких, триботехнических покрытий в узлах трения. На основе настоящего изобретения и с использованием указанного нового способа нанесения покрытий могут быть получены и многослойные покрытия с чередованием слоев вольфрама и слоев, содержащих карбиды вольфрама, легированные фтором и, возможно, фторуглеродными композициями, в том числе в смеси между собой, с вольфрамом или углеродом. Толщины отдельных чередующихся слоев находятся в соотношении от 1:1 до 1:5. Объектом настоящего изобретения является и сам конструкционный материал, имеющий двуслойное или многослойное покрытие, выполненное CITY TO THE PROPERTY OF THE PR

Примеры осуществления изобретения

20

30

Хотя не исключается возможность использования самих карбидов вольфрама, получаемых в соответствии с настоящим изобретением, в качестве конструкционного материала, однако преимущественным случаем их использования является нанесение их на конструкционные материалы и изделия из них в качестве износостойких покрытий. Поэтому, представленные ниже примеры иллюстрируют изобретение именно на случаях осаждения карбидов на подложки в качестве их покрытий. Однако эти случаи не ограничивают объема изобретения только ими, поскольку возможно получение патентуемым способом и других комбинаций карбидов вольфрама между собой и / или с вольфрамом и / или с углеродом.

15

Представленные примеры касаются получения сложных покрытий, когда слой покрытия, содержащий тот или иной карбид вольфрама или смеси карбидов между собой, с вольфрамом, углеродом осаждается на слой вольфрама, осажденный до этого на подложку. Примеры охватывают случаи двуслойных покрытий (внутренний слой вольфрама и внешний, содержащий карбид(ы) вольфрама) и многослойных покрытий, с чередованием слоев вольфрама и слоев, содержащих карбид(ы) вольфрама.

Конструкционный материал, на который наносят композитное покрытие (или его внешний по отношению к покрытию слой, в случае биметалла) содержит основу из различных сортов твердого сплава, керамик, таких как карбид кремния, нитрид кремния, оксид алюминия, циркония, углерод-углеродные композиционные материалы и т.д., ряда железосодержащих сплавов, таких как железо, углеродистые стали, нержавеющие стали, инструментальные и быстрорежущие стали, чугуны или иные материалы, выбранные из ряда: медь. серебро, золото, кобальт, никель, родий, рений. платина, иридий, кремний, тантал, ниобий, ванадий, вольфрам, молибден, углерод, азот, бор, сплавы. титановые также смеси, их сплавы, соединения И Предпочтительно, чтобы конструкционный материал или его внешний слой по отношению к покрытию состоял из сплавов с содержанием никеля выше 25 ат.%, например, инвар, нихром, монель и другие.

В случае осаждения на химически активные материалы такие как: железо, углеродистые стали, нержавеющие стали, инструментальные и быстрорежущие стали, чугуны, титановые сплавы, титаносодержащие твердые сплавы, предпочтительно наносить на них промежуточные покрытия, содержащие материалы химически стойкие во фтористом водороде, выбранные из ряда: медь, серебро, золото, кобальт, никель, родий, рений, платина, иридий, тантал, молибден, ниобий, ванадий, бор путем электрохимического или химического осаждения из водных растворов, электролиза расплавов, химического или физического газофазного осаждения, например путем магнетронного распыления, и иными методами до получения толщины промежуточных слоев от 0,5 до 20 мкм.

Промежуточные покрытия полученные указанными выше методами необходимо подвергнуть термической обработке при температуре 400-900°C в течение 0,5 - 1 час в токе водорода или инертного газа.

В случае осаждения на материалы химически стойкие во фтористом водороде, такие как медь, серебро, золото, кобальт, никель, родий, рений, платина, иридий, тантал, молибден, вольфрам, ниобий, графит, карбиды и керамики промежуточные покрытия не наносят. Различные детали сложной формы, выполненные из материала предлагаемых композитных покрытий, производятся путем осаждения их на медь, серебро, золото, кобальт, никель, 10 родий, рений, платина, иридий, тантал, молибден, вольфрам, ниобий, графит с последующим удалением подложек путем химического, электрохимического травления или иными методами.

Обезжиренные и очищенные от посторонних примесей подложки укладываются во внутрь химического прямоточного реактора, снабженного 15 электрическим нагревателем. Химический реактор вакуумируется при помощи форвакуумного насоса с азотной вымораживающей ловушкой до имы казымыны протород на предоставания протород на при на предоставания на предоставания на предоставания на п

После этого реактор с деталями нагревается до требуемой температуры и выдерживается при этой температуре 0,5-1 час. Затем устанавливается необходимый расход водорода и требуемое общее давление в реакторе. Затем устанавливается необходимый расход гексафторида вольфрама, нагретого предварительно до 30°С. После выдерживания деталей в заданных условиях в течение необходимого для нанесения внутреннего вольфрамового слоя устанавливают требуемое общее давление и в реакционную смесь добавляют 25 определенный расход углеродсодержащего газа, например пропана, предварительно нагретого до необходимой температуры. При повторении операций получают многослойное композиционное покрытие. Затем прекращают подачу газа и выдерживают подложки в течение 0,5-1 час при неизменной температуре. После этой выдержки температура реактора снижается до комнатной при непрерывной подаче водорода или аргона. Затем подача водорода или аргона прекращается, реактор вакуумируется до

максимального разрежения и в реактор пускается воздух. После чего подложки с композитным покрытием извлекаются из реактора. Конкретные примеры описанного выше способа нанесения композитного покрытия описаны ниже. При этом испытания на твердость и определение фазового состава покрытия осуществлялись следующим образом.

Испытания на твердость

Определение твердости покрытий проводили на приборе ПМТ-3. Образцы 10 из сталей и твердых сплавов с нанесенным композитным покрытием разрезали поперек и шлифовали поперечный срез сначала абразивными шкурками, затем полировали алмазной пастой до максимально гладкой поверхности. Микротвердость покрытий определяли путем вдавливания алмазной пирамидки на приборе ПМТ-3 в середину по толщине внешнего поперечном композитного покрытия на внутреннего слоя отполированном срезе образца. Данные усреднялись по 7-10 измерениям. По результатам исследования установлено, что микротвердость внутреннего $\kappa\Gamma/\text{мм}^2$, микротвердость 350-600 составляет вольфрамового слоя монокарбида вольфрама (WC) составляет 1900 кГ/мм², полукарбида 20 вольфрама (W_2 C) - 3000 к Γ /мм², субкарбида W_3 C - 3100 к Γ /мм². Субкарбид вольфрама (W12C) обладает максимальной микротвердостью равной 3500 кГ/мм². Смеси карбидов вольфрама между собой обладают промежуточными значениями твердости.

Многослойные покрытия характеризовались средним значением твердости.

25 В этом случае нагрузку алмазной пирамидки подбирали таким образом, чтобы отпечаток захватывал не менее 4-х слоев многослойного покрытия. Измерения твердости повторяли также 7-10 раз.

Определение фазового состава композитного покрытия

рентгенографическим определяли осадков состав Фазовый электроннографическим методами. Рентгеноструктурные исследования проводили на дифрактометре ДРОН-3 с использованием медного излучения на плоских образцах размером 10х10 мм. Качественный фазовый анализ фаз W, WC, W_{2} C, W_{3} C, W_{12} C, C проводили методом идентификации линий отражения по данным ASTM. Исследование фазового состава композиций карбидов вольфрама со свободным углеродом дополнительно проводили с помощью метода просвечивающей электронной микроскопии. Кроме того, определение фазового состава дополняли химическим анализом на общее содержание вольфрама, углерода и фтора. Для этого внешний слой покрытия отделяли от медной подложки растворением в азотной кислоте, затем измельчали и определяли химический состав вещества покрытия с помощью методов аналитической химии.

15 Пример 1. . . .

Образец из углеродистой стали (Ст 3) с нанесенным на него слоем никеля толщиной 6 мкм элексирохимилистический стали (WF₆) и водорода (H₂) при их соотношении 0,12 в течение 5 мин и затем в среде WF₆, H₂ и пропана (C₃H₈) при соотношении WF₆ к H₂ равном 0,12 и соотношении C₃ H₈ к H₂ равном 1.8 в течение 60 мин при предварительной термоактивации C₃H₈ при 850 \circ C и давлении реакционной смеси 2 кПа.

В результате получаем материал, имеющий основу из стали 3 с промежуточным никелевым слоем 8 мкм и композитным покрытием с внутренним слоем вольфрама (W) толщиной 5 мкм и наружным слоем из смеси WC и свободного углерода (сажи) толщиной 40 мкм. Микротвердость покрытия - 840 кГ/мм², покрытие с грубыми включениями сажи.

Пример 2.

30 Образец из нержавеющей стали (X18H10T) с нанесенным на него слоем никеля толщиной 10 мкм электрохимическим способом выдерживается в печи при температуре 800°С в среде гексафторида вольфрама (WF $_6$) и водорода (H $_2$) при их соотношении 0,11 в течение 5 мин и затем в среде WF $_6$, H $_2$ и пропана (C $_3$ H $_8$) при соотношении WF $_6$ к H $_2$ равном 0,11 и соотношении С $_3$ H $_8$ к H $_2$ равном 1,6 в течение 60 мин при предварительной термоактивации С $_3$ H $_8$ при 840°С и давлении реакционной смеси 8,8 кПа.

В результате получаем материал, имеющий основу из нержавеющей стали (X18Н10Т) с промежуточным никелевым слоем 10 мкм и композитным покрытием с внутренним слоем вольфрама (W) толщиной 5 мкм и наружным слоем из смеси WC и свободного углерода толщиной 35 мкм.

10 Микротвердость покрытия - 1150 к Γ /мм².

Пример 3.

Образец из нержавеющей стали (0X18H10T) с нанесенным на него слоем никеля толщиной 7 мкм электрохимическим способом выдерживается в реакционной камере при температуре 700°С в среде гексафторида вольфрама (WF₆) и водорода (H₂) при их соотношении 0,085 в течение 1 мин и затем в среде WF₆, H₂ и пропана (C₃H₈) при соотношении WF₆ к H₂ равном 0,085 и соотношении C₃H₈ к H₂ равном 1,2 в течение 2,0 мин при предварительной термоактивации C₃H₈ при 770°С и давлении реакционной смеси 5,2 кПа.

20 В результате получаем конструкционный материал, имеющий основу из стали 0X18Н10Т с промежуточным никелевым слоем 7 мкм и композитным покрытием с внутренним слоем вольфрама (W) толщиной 0,7 мкм и наружным слоем из WC толщиной 8 мкм. Микротвердость покрытия - 1900 кГ/мм².

25

Пример 4.

Образец из твердого сплава ВК-10 выдерживается в реакционной камере при температуре 650 °C в среде гексафторида вольфрама (WF₆) и водорода (H₂) при их соотношении 0.08 в течение 1 мин и затем в среде WF₆, H₂ и пропана (C₃H₈) при соотношении WF₆ к H₂ равном 0.08 и соотношении С H₃ к H₄

равном 0,95 в течение 80 мин при предварительной термоактивации C_3H_8 при 730 \circ C и давлении реакционной смеси 8,8 кПа.

В результате получаем конструкционный материал, имеющий основу из твердого сплава ВК-10 и композитное покрытие, состоящее из внутреннего слоя вольфрама (W) толщиной 0,7 мкм и наружного слоя из смеси W_2C с WC толщиной 32 мкм. Микротвердость покрытия - 2800 к Γ /мм².

Пример 5.

Образец из инструментальной стали $3X2B8\Phi$ с нанесенным на него слоем никеля толщиной 5 мкм электрохимическим способом выдерживается в реакционной камере при температуре $600 \, ^{\circ}$ С в среде гексафторида вольфрама (WF₆) и водорода (H₂) при их соотношении 0,08 в течение 2 мин и затем в среде WF₆, H₂ и пропана (C₃H₈) при соотношении WF₆ к H₂ равном 0,08 и соотношении C₃H₈ к H₂ равном 0,80 в течение 30 мин при предварительной термоактивации C₃H₈ при 700 $^{\circ}$ С и давлении реакционной смеси 8,8 кПа. Химический анализ покрытия показал содержание фтора $5 \cdot 10^{-2}$ вес. %.

В результате получаем конструкционным манерикан, имперента и композитное покрытие, состоящее из внутреннего слоя вольфрама (W) толщиной 1,3 мкм и наружного слоя из W_2 С толщиной 9,1 мкм. Микротвердость покрытия - 2800 к Γ /мм².

Пример 6.

20

Образец из инструментальной стали Р 18 с нанесенным на него слоем никеля толщиной 5 мкм электрохимическим способом выдерживается в реакционной камере при температуре 550°С в среде гексафторида вольфрама (WF₆) и водорода (H₂) при их соотношении 0,057 в течение 5 мин и затем в среде WF₆, H₂ и пропана (C₃H₈) при соотношении WF₆ к H₂ равном 0,057 и соотношении C₃H₈ к H₂ равном 0,67 в течение 70 мин при предварительной термоактивации C₃H₈ при 640°С и давлении реакционной смеси 5,2 кПа.

30 В результате получаем конструкционный материал, имеющий основу из стали Р 18 с промежуточным слоем никеля 5 мкм и композитное покрытие,

состоящее из внутреннего слоя вольфрама (W) толщиной 3 мкм и наружного слоя из смеси W_2C и W_3C толщиной 25 мкм. Микротвердость покрытия - 2950 к $\Gamma/$ мм².

5 Пример 7.

Образец из инструментальной стали X12Ф1 с нанесенным на него слоем никеля толщиной 7 мкм электрохимическим способом выдерживается в реакционной камере при температуре 540°С в среде гексафторида вольфрама (WF₆) и водорода (H₂) при их соотношении 0,053 в течение 2 мин и затем в среде WF₆, H₂ и пропана (C₃H₈) при соотношении WF₆ к H₂ равном 0,053 и соотношении С₃H₈ к H₂ равном 0,63 в течение 40 мин при предварительной термоактивации С₃H₈ при 635°С и давлении реакционной смеси 28 кПа. В результате получаем конструкционный материал, имеющий основу из стали X12Ф1 и композитное покрытие, состоящее из внутреннего слоя вольфрама (W) толщиной 1,0 мкм и наружного слоя из W₃C толщиной 18 мкм. Микротвердость покрытия - 3120 кГ/мм².

Пример 8.

Образец из инструментальной стали P6M5 с нанесенным на него электрохимическим способом слоем никеля толщиной 5 мкм выдерживается в реакционной камере при температуре $520 \, ^{\circ}$ С в среде гексафторида вольфрама (WF6) и водорода (H2) при их соотношении 0,045 в течение 5 мин и затем в среде WF6, H2 и пропана (C3H8) при соотношении WF6 к H2 равном 0,045 и соотношении C3H8 к H2 равном 0,60 в течение 180 мин при предварительной термоактивации C3H8 при 610 С и давлении реакционной смеси 42 кПа.

В результате получаем конструкционный материал, имеющий основу из стали P6M5 с промежуточным слоем никеля 5 мкм и композитное покрытие, состоящее из внутреннего слоя вольфрама (W) толщиной 3 мкм и наружного слоя из смеси W_3C и $W_{12}C$ толщиной 100 мкм. Микротвердость покрытия - 3400 к Γ /мм².

Пример 9.

Образец из инструментальной стали $3X2B8\Phi$ с нанесенным на него электрохимическим способом слоем никеля толщиной 5 мкм выдерживается в реакционной камере при температуре $520 \circ C$ в среде гексафторида вольфрама (WF₆) и водорода (H₂) при их соотношении 0,044 в течение 2 мин и затем в среде WF₆, H₂ и пропана (C₃H₈) при соотношении WF₆ к H₂ равном 0,044 и соотношении C₃H₈ к H₂ равном 0,4 в течение 160 мин при предварительной термоактивации C₃H₈ при 600 \circ C и давлении реакционной смеси 28 кПа.

0 В результате получаем конструкционный материал, имеющий основу из стали $3X2B8\Phi$ с промежуточным слоем никеля толщиной 5 мкм и композитное покрытие, состоящее из внутреннего слоя вольфрама (W) толщиной 1 мкм и наружного слоя из $W_{12}C$ толщиной 78 мкм. Микротвердость покрытия - $3500 \text{ к}\Gamma/\text{мм}^2$.

15

Пример 10.

Образец из нержавеющей стали 2X15 е имнесенным на нево электрохимическим способом слоем никеля толщиной 10 мкм выдерживается в реакционной камере при температуре $520 \, ^{\circ}$ С в среде гексафторида вольфрама (WF₆) и водорода (H₂) при их соотношении 0,070 в течение 4 мин и затем в среде WF₆, H₂ и пропана (C₃H₈) при соотношении WF₆ к H₂ равном 0,070 и соотношении C₃H₈ к H₂ равном 0,20 в течение 60 мин при предварительной термоактивации C₃H₈ при 650 $^{\circ}$ С и давлении реакционной смеси 8,8 кПа.

- 25 В результате получаем конструкционный материал, имеющий основу из стали 2X13 и композитное покрытие, состоящее из внутреннего слоя вольфрама (W) толщиной 3,8 мкм и наружного слоя из смеси $W_{12}C$ и W толщиной 20 мкм. Микротвердость покрытия 2150 к Γ /мм².
- 30 Пример 11.

Образец из сплава "монель" выдерживается в реакционной камере при температуре 580°С в среде гексафторида вольфрама (WF₆) и водорода (H₂) при их соотношении 0,085 в течение 3 мин и затем в среде WF₆, H₂ и пропана (C₃H₈) при соотношении WF₆ к H₂ равном 0,085 и соотношении 5 С₃H₈ к H₂ равном 0,80 в течение 60 мин при предварительной термоактивации С₃H₈ при 680°С и давлении реакционной смеси 8,8 кПа. В результате получаем конструкционный материал, имеющий основу из сплава "монель" и композитное покрытие, состоящее из внутреннего слоя вольфрама (W) толщиной 3,5 мкм и наружного слоя из смеси W₂C и W толщиной 35 мкм. Микротвердость покрытия - 1740 кГ/мм².

Пример 12.

Образец из инварного сплава К6Н38Ф выдерживается в реакционной камере при температуре 590°С в среде гексафторида вольфрама (WF₆) и водорода (H₂) при их соотношении 0,063 в течение 3 мин и затем в среде WF₆, H₂ и пропана (C₃H₈) при соотношении WF₆ к H₂ равном 0,063 и соотношении C₃H₈ к H₂ равном 0,63 в течение 40 мин при предварительной термоактивации C₃H₈ при 630°С и давлении реакционной смеси 8,8 кПа. В результате получаем конструкционный материал, имеющий основу из сплава К6Н38Ф и композитное покрытие, состоящее из внутреннего слоя вольфрама (W) толщиной 3 мкм и наружного слоя из смеси W₃C и W толщиной 19 мкм. Микротвердость покрытия - 1690 кГ/мм². Пример 13.

Образец из спека натуральных алмазов выдерживается в реакционной камере при температуре 520°С в среде гексафторида вольфрама (WF₆) и водорода (H₂) при их соотношении 0,048 в течение 1 мин и затем в среде WF₆, H₂ и пропана (C_3H_8) при соотношении WF₆ к H₂ равном 0,048 и соотношении C_3H_8 к H₂ равном 0,65 в течение 48 мин при предварительной термоактивации C_3H_8 при 700°С и давлении реакционной смеси 42 кПа.

30 В результате получаем конструкционный материал, имеющий основу из спека натуральных алмазов и композитное покрытие, состоящее из

внутреннего слоя вольфрама (W) толщиной 0,8 мкм и наружного слоя из смеси W_2C и W_{12} C толщиной 12 мкм. Микротвердость покрытия - 3220 к $\Gamma/$ мм 2 .

5 Пример 14.

10

Образец из нихрома выдерживается в реакционной камере при температуре $560 \circ C$ в среде гексафторида вольфрама (WF₆) и водорода (H₂) при их соотношении 0.070 в течение 8 мин и затем в среде WF₆, H₂ и пропана (C₃H₈) при соотношении WF₆ к H₂ равном 0.070 и соотношении C₃H₈ к H₂ равном 0.2 в течение 40 мин при предварительной термоактивации C₃H₈ при $650 \circ C$ и давлении реакционной смеси 5.2 кПа.

В результате получаем конструкционный материал, имеющий основу из нихрома и композитное покрытие, состоящее из внутреннего слоя вольфрама (W) толщиной 7 мкм и наружного слоя из смеси W и C толщиной 41 мкм.

15 Микротвердость покрытия - 1210 к Γ / мм².

HEDNALGORI HAI ALGORATANOMINATOR CITTOR

Пример 15.

Образец из твердого сплава ВК 6 выдерживается в реакционной камере при температуре 620∘С: а) в среде гексафторида вольфрама (WF₆) и водорода (H₂) при их соотношении 0,08 в течение 2 мин и 6) в среде WF₆, H₂ и C₃H₈ при соотношении WF₆ к H₂ равном 0,08 и соотношении С H₂ к H₂ равном 1,5 в течение 16 мин при предварительной термоактивации C₃H₈ при 750∘С и давлении реакционной смеси 5,2 кПа. Операции "а" и "6" повторяются последовательно 4 раза. Содержание фтора в многослойном покрытии 9·10³ вес. %.

В результате получаем конструкционный материал, имеющий основу из твердого сплава ВК 6 и композиционным покрытием из 4 чередующихся слоев W толщиной 3,0 мкм и WC толщиной 7,0 при соотношении их толщин

1:2,3 и общей толщиной композиционного покрытия 40 мкм. Средняя микротвердость покрытия - 1320 к $\Gamma/$ мм 2 .

Пример 16.

Образец из твердого сплава ВК 10 выдерживается в реакционной камере при температуре 650∘С: а) в среде гексафторида вольфрама (WF₆) и водорода (H₂) при их соотношении 0,08 в течение 1 мин и 6) в среде WF₆, H₂ и C₃H₈ при соотношении WF₆ к H₂ равном 0,08 и соотношении C₃H₈ к H₂ равном 0,95 в течение 80 мин при предварительной термоактивации C₃H₈ при 730∘С и давлении реакционной смеси 8,8 кПа. Операции "а" и "6" повторяются последовательно 4 раза.

В результате получаем конструкционный материал, имеющий основу из твердого сплава ВК 10 и композиционным покрытием из 4 чередующихся слоев W толщиной 0,7 мкм и смеси WC с W_2 C толщиной 32 при соотношении их толщин 1:45,7 и общей толщиной композиционного покрытия 130,8 мкм. Средняя микротвердость покрытия - 2200 к Γ /мм 2 .

Пример 17.

Образец из инструментальной стали (ЗХ2В8Ф) с нанесенным на него слоем 20 никеля 5 мкм электрохимическим методом выдерживается в реакционной камере при температуре 600°С: а) в среде гексафторида вольфрама (WF₆) и водорода (H₂) при их соотношении 0,080 в течение 2 мин и 6) в среде WF₆, H₂ и C₃H₈ при соотношении WF₆ к H₂ равном 0,080 и соотношении C₃H₈ к H₂ равном 0,7 в течение 25 мин при предварительной термоактивации C₃H₈ при 700°С и давлении реакционной смеси 8,8 кПа. Операции "а" и "б" повторяются последовательно 5 раз.

В результате получаем конструкционный материал, имеющий основу из стали ($3X2B8\Phi$) и композиционное покрытие из 5 чередующихся слоев W и W_2 C толщиной 1,5 и 7,5 мкм соответственно при соотношении их толщин 1:5 и общей толщиной композиционного покрытия 45 мкм. Средняя микротвердость покрытия - $2340 \text{ к}\Gamma/\text{мм}^2$.

Пример 18.

Образец из инварного сплава К6Н38 Φ выдерживается в реакционной камере при температуре 580 \circ C: а) в среде гексафторида вольфрама (WF₆) и водорода (H₂) при их соотношении 0,060 в течение 5 мин и б) в среде WF₆,

5 H_2 и C_3H_8 при соотношении WF $_6$ к H_2 равном 0,06 и соотношении C_3H_8 к H_2 равном 0,70 в течение 40 мин при предварительной термоактивации C_3H_8 при 650 \circ C и давлении реакционной смеси 8,8 кПа. Операции "а" и "6" повторяются последовательно 12 раз.

В результате получаем конструкционный материал, имеющий основу из сплава К6Н38Ф и композиционное покрытие из 12 чередующихся слоев W толщиной 3,0 мкм и смеси W_2C с W_3C толщиной 15,1 мкм при соотношении их толщин 1:5 и общей толщиной композиционного покрытия 217 мкм. Средняя микротвердость покрытия - 2150 к Γ /мм².

15 Пример 19.

Образец из инструментальной стали $X12\Phi1$ с нанесенным слоем никеля томпиной и мкм электрохими X в среде гексафторида вольфрама (WF₆) и водорода (H₂) при их соотношении 0,053 в течение 3 мин и 6) в среде X WF₆, H₂ и C₃H₈ при соотношении WF₆ к H₂ равном 0,053 и соотношении X C₃H₈ к H₂ равном 0.62 в течение 27 мин при предварительной термоактивации X при 635°C и давлении реакционной смеси 28 кПа. Операции "а" и "6" повторяются последовательно 5 раз.

В результате получаем конструкционный материал, имеющий основу из инструментальной стали $X12\Phi1$ и композиционное покрытие из 5 чередующихся слоев W и W_3 C толщиной 5 и 12 мкм соответственно при соотношении их толщин 1:264 и общей толщиной композиционного покрытия 85 мкм. Средняя микротвердость покрытия - 2250 к Γ /мм².

30 Пример 20.

Образец из углеродистой стали 45 с нанесенным на него электрохимическим способом слоем никеля толщиной 6 мкм выдерживается в реакционной камере при температуре $540 \, ^{\circ}$ C: а) в среде гексафторида вольфрама (WF₆) и водорода (H₂) при их соотношении 0,047 в течение 9 мин и 6) в среде WF₆, H₂ и C₃ H₈ при соотношении WF₆ к H₂ равном 0,047 и соотношении C₃H₈ к H₂ равном 0,55 в течение 150 мин при предварительной термоактивации C₃H₈ при 630 $^{\circ}$ C и давлении реакционной смеси 5,2 кПа. Операции "а" и "6" повторяются последовательно 7 раз.

В результате получаем конструкционный материал, имеющий основу из стали 45 с промежуточным слоем никеля толщиной 6 мкм и композиционное покрытие из 7 чередующихся слоев W и смеси W_3C с $W_{12}C$ толщиной 4 и 44 мкм соответственно при соотношении их толщин 1:11 и общей толщиной композиционного покрытия 396 мкм. Средняя микротвердость покрытия - 2900 к $\Gamma/\text{мм}^2$.

15

Пример 21.

Образец из инструментальной стали P6M5 с нанесенным на него магнетронным распылением слоем никеля толщиной 3 мкм выдерживается в реакционной камере при температуре 520°С: а) в среде гексафторида вольфрама (WF₆) и водорода (H₂) при их соотношении 0,050 в течение 8 мин и 6) в среде WF₆, H₂ и C₃H₈ при соотношении WF₆ к H₂ равном 0,043 и соотношении C₃H₈ к H₂ равном 0,35 в течение 11 мин при предварительной термоактивации C₃H₈ при 650°С и давлении реакционной смеси 8,8 кПа. Операции "а" и "6" повторяются последовательно 11 раз.

В результате получаем конструкционный материал, имеющий основу из стали Р6М5 с промежуточным слоем никеля толщиной 8 мкм и композиционное покрытие из 11 чередующихся слоев W и W₁₂C толщиной 5 и 5 мкм соответственно, при соотношении их толщин 1:1 и общей толщиной композиционного покрытия 110 мкм. Средняя микротвердость покрытия - 2550 кГ/мм².

Пример 22.

Образец из титанового сплава ВТ 1 с нанесенным на него магнетронным методом слоем никеля толщиной 1 мкм выдерживается в реакционной камере при температуре 600°C: а) в среде гексафторида вольфрама (WF₆) и водорода (H₂) при их соотношении 0,045 в течение 4 мин и 6) в среде WF₆, H₂ и C₃H₈ при соотношении WF₆ к H₂ равном 0,045 и соотношении C₃H₈ к H₂ равном 0,65 в течение 60 мин при предварительной термоактивации C₃H₈ при 600°C и давлении реакционной смеси 42 кПа. Операции "a" и "6" повторяются последовательно 15 раз.

10 В результате получаем конструкционный материал, имеющий основу из сплава ВТ 1 и композиционное покрытие из 15 чередующихся слоев W и смеси W_2C с $W_{12}C$ толщиной 5,2 и 20 мкм соответственно, при соотношении их толщин 1:3,8 и общей толщиной композиционного покрытия 378 мкм. Средняя микротвердость покрытия - 2220 к Γ /мм².

15

Пример 23.

камере при температуре 510°C: а) в среде гексафторида вольфрама (WF₆) и водорода (H₂) при их соотношении 0,045 в течение 1 мин и 6) в среде WF_6 , H₂ и C₃ H₆ при соотношении WF₆ к H₂ равном 0,045 и соотношении C_3H_8 к H₂ равном 0,35 в течение 50 мин при предварительной термоактивации C_3H_8 при 520°C и давлении реакционной смеси 42 кПа. Операции "а" и "6" повторяются последовательно 12 раз. Химический анализ покрытия показал содержание фтора 3,0 ·10 · вес. %

- 25 В результате получаем конструкционный материал, имеющий основу из нитридокремниевой керамики и композиционное покрытие из 12 чередующихся слоев W и смеси W с W_{12} C толщиной 0,7 и 16 мкм соответственно, при соотношении их толщин 1:22,8 и общей толщиной композиционного покрытия 204 мкм. Средняя микротвердость покрытия -
- 30 2220 $\kappa\Gamma/mm^2$.

Пример 24.

Образец из титанового сплава ВТ 1 с нанесенным на него слоем никеля толщиной 2 мкм магнетронным распылением выдерживается в реакционной камере при температуре $600 \, ^{\circ}$ C: а) в среде гексафторида вольфрама (WF₆) и водорода (H₂) при их соотношении 0,09 в течение 3 мин и 6) в среде WF ₆ H₂ и C₃H₈ при соотношении WF₆ к H₂ равном 0,09 и соотношении C₃H₈ к H₂ равном 0,7 в течение 40 мин при предварительной термоактивации C₃H₈ при 720 $^{\circ}$ C и давлении реакционной смеси 5,2 кПа. Операции "а" и "6" повторяются последовательно 7 раз.

10 В результате получаем конструкционный материал, имеющий основу из сплава ВТ 1 с промежуточным слоем никеля толщиной 2 мкм и композиционное покрытие из 7 чередующихся слоев W и смеси W с W₂C толщиной 4,2 и 21,5 мкм соответственно при соотношении их толщин 1:5,1 и общей толщиной композиционного покрытия 179,9 мкм. Средняя микротвердость покрытия - 1830 кГ/мм².

Пример 25.

Образец из инструментальной стали 3ХЗМЗФ с нанесенным на него слоем никеля толщиной 6 мкм электрохимическим методом выдерживается в 20 реакционной камере при температуре 500°С: а) в среде гексафторида вольфрама (WF₆) и водорода (H₂) при их соотношении 0,055 в течение 5 мин и 6) в среде WF₆, H₂ и C₃H₈ при соотношении WF₆ к H₂ равном 0,055 и соотношении C₃H₈ к H₂ равном 0,65 в течение 120 мин при предварительной термоактивации C₃H₈ при 560°С и давлении реакционной смеси 8,8 кПа. Операции "а" и "6" повторяются последовательно 4 раза. В результате получаем конструкционный материал, имеющий основу из стали 3ХЗМЗФ и композиционное покрытие из 4 чередующихся слоев W и смеси W с W₃C толщиной 3,8 и 44,1 мкм соответственно, при соотношении их толщин 1:11,6 и общей толщиной композиционного покрытия 191,6 мкм.

30 Средняя микротвердость покрытия - 1320 к $\Gamma/$ мм 2 .

Промышленная применимость

стального, упрочении при использоваться Изобретение тэжом твердосплавного и алмазного инструмента, который применяется для обработки материалов резанием или давлением. Последнее является наиболее перспективной областью применения предлагаемой технологии в связи с отсутствием конкурирующих технологий покрытий при изготовлении прессового инструмента сложной геометрии при производстве проволоки, труб, профильной продукции из алюминия, меди, стали и других металлов 10 и сплавов. Указанные карбидовольфрамовые покрытия можно наносить на инструменты и формы, предназначенные для формования изделий из пластмасс, силикатных масс и других абразивных смесей. Другой сферой применения является нанесение эрозионностойких покрытий

Другой сферой применения является нанесение эрозионностойких покрытий на лопатки турбин, на насадки установок для гидроабразивной резки,

15 обработки поверхностей, размывки породы и т.д.

Изобретение перспективно для машиностроительной отрасли при изготовлетии авторительной отрасли при необходима повышенная износостойкость трущихся деталей. Высокий экономический эффект можно ожидать от нанесения указанных покрытий на прессовый инструмент (штампы, матрицы и т.д.) для изготовления машиностроительных изделий.

Обширный класс нефтегазового оборудования (наземные, погружные насосы, фонтанная арматура и др.) может быть существенно улучшен при помощи износо- и коррозионностойких покрытий, полученных в соответствии с настоящим изобретением.

י אוך

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

- 1. Материал для покрытий, устойчивых к износу, эрозии и коррозии представляющий собой карбид вольфрама, легированный фтором в количестве от 0,0005 до 0,5 вес %.
- 2. Материал по п. 1, представляющий собой монокарбид вольфрама WC, легированный фтором в количестве от 0,0005 до 0,5 вес %.
- 3. Материал по п. 1, представляющий собой полукарбид вольфрама W_2C , легированный фтором в количестве от 0,0005 до 0,5 вес %.
 - 4. Материал по п. 1, представляющий собой субкарбид вольфрама W_3C , легированный фтором в количестве от 0,0005 до 0,5 вес %.
- 15 5. Материал по п. 1, представляющий собой субкарбид вольфрама $W_{12}C$, легированный фтором в количестве от 0,0005 до 0,5 вес %.
- 6. Материал по п.1-5, отличающийся тем, что он дополнительно содержит фторуглеродные композиции с содержанием углерода до 15 вес % и фтора до 0,5 вес %.
- Материал для покрытий, устойчивых к износу, эрозии и коррозии, представляющий собой смесь по меньшей мере двух карбидов вольфрама, легированных фтором в количестве от 0,0005 до 0,5 вес. %. и ,возможно, фторуглеродными композициями с содержанием углерода до 15 вес. % и фтора до 0,5 вес. %.
 - 8. Покрытие, отличающееся тем, что оно включает:
 - внутренний слой, наносимый на подложку, выполненный из вольфрама

- внешний слой, наносимый на указанный внутренний слой и содержащий карбид вольфрама в соответствии с пп.1 -6.
- 9. Покрытие по п. 6, отличающееся тем, что внешний слой дополнительно содержит смесь карбидов вольфрама в соответствии с п. 7
 - 10. Покрытие по пп. 8 или 9, отличающееся тем, что внешний слой дополнительно содержит вольфрам.
- 10 11. Покрытие по п. 8 или 9, отличающееся тем, что внешний слой дополнительно содержит углерод.
 - 12. Покрытие по любому из пунктов 8-11, отличающееся тем, что внутренний слой имеет толщину 0,5-300 мкм, наружный слой имеет толщину 0,5-300 мкм, при соотношении толщины внутреннего и наружного слоем от 1:1 до 1:600.
 - 13. Способ получения карбидов вольфрама путем химического газофазного осаждения на нагретой подложке с использованием смеси газов,
 включающий гексафторид вольфрама, водород, углеродсодержащий газ, и, не обязательно, инертный газ, отличающийся тем, что углеродсодержащий газ предварительно активируют путем нагрева до температуры 500-850 °C.
 - 14. Способ по п. 13, отличающийся тем, что в качестве углеродсодержащего газа используют пропан.
 - 15. Способ по пп. 13 14, отличающийся тем, что процесс ведут при давлении 2 150 кПА, температуре подложки 400-900 °C, соотношении углеродсодержащего газа к водороду 0,2-1,7, соотношении гексафторида вольфрама к водороду 0,02-0,12.

16. Способ по п. 15, отличающийся тем, что процесс ведут при соотношении углеродсодержащего газа к водороду 1,0-1,5, гексафторида вольфрама к водороду 0,08 - 0,10, углеродсодержащий газ предварительно нагревают до температуры 750 - 850 °C, при этом получают монокарбид вольфрама WC.

5

17. Способ по п. 15, отличающийся тем, что процесс ведут при соотношении углеродсодержащего газа к водороду 0,75-0,90, гексафторида вольфрама к водороду 0,06 - 0,08, углеродсодержащий газ предварительно нагревают до температуры 600 - 750 $^{\rm o}$ C, при этом получают полукарбид вольфрама W_2 C.

10

18. Способ по п. 15, отличающийся тем, что процесс ведут при соотношении углеродсодержащего газа к водороду 0,60-0,65, гексафторида вольфрама к водороду 0,05 - 0,055, углеродсодержащий газ предварительно нагревают до температуры 560 - 720 $^{\rm o}$ C, при этом получают субкарбид вольфрама W_3 C.

15

19. Способ по п. 15, отличающийся тем, что процесс ведут при соотношении углеродсодержащего газа к водороду 0,35-0,45, гексафторида вольфрама к водороду 0,040 - 0,045, углеродсодержащий газ предварительно нагревают до температуры 500 - 700 $^{\rm o}$ C, при этом получают субкарбид вольфрама W_{12} C.

20

20. Способ по п. 15, отличающийся тем, что процесс ведут при соотношении углеродсодержащего газа к водороду 0,90-1,00, гексафторида вольфрама к водороду 0,07 - 0,09, углеродсодержащий газ предварительно нагревают до температуры 670 - 790 $^{\circ}$ C, при этом получают смесь карбидов WC и W_{2} C.

25

21. Способ по п. 15, отличающийся тем, что процесс ведут при соотношении углеродсодержащего газа к водороду 0,70-0,75, гексафторида вольфрама к водороду 0,055 - 0,060, углеродсодержащий газ предварительно нагревают до температуры 580 - 730 0 C, при этом получают смесь карбидов W_{2} C и W_{3} C.

- 22. Способ по п. 15, отличающийся тем, что процесс ведут при соотношении углеродсодержащего газа к водороду 0,60-0,65, гексафторида вольфрама к водороду 0,045 0,060, углеродсодержащий газ предварительно нагревают до температуры 570 700 0 C, при этом получают смесь карбидов W_{2} C и W_{12} C.
- 23. Способ по п. 15, отличающийся тем, что процесс ведут при соотношении углеродсодержащего газа к водороду 0,45-0,60, гексафторида вольфрама к водороду 0,045 0,050, углеродсодержащий газ предварительно нагревают до температуры 550 680 $^{\rm 0}$ C, при этом получают смесь карбидов W_3 C и W_{12} C.
 - 24. Способ по п. 15, отличающийся тем, что процесс ведут при соотношении углеродсодержащего газа к водороду 0.65-0.70, гексафторида вольфрама к водороду 0.045 0.060, углеродсодержащий газ предварительно нагревают до температуры 570 710 °C, при этом получают смесь карбидов W_2 C, W_3 C и W_3 C.
 - 25. Способ по п. 15, отличающийся тем, что процесс ведут при соотношении углеродсодержащего газа к водороду 0,70-0,90, гексафторида вольфрама к водороду 0,08 0.09, углеродсодержащий газ предварительно нагревают до температуры 600 720 °C, при этом получают смесь карбида WC и вольфрама.
 - 25 26. Способ по п. 15, отличающийся тем, что процесс ведут при соотношении углеродсодержащего газа к водороду 0,70-0,90, гексафторида вольфрама к водороду 0,08 0,09, углеродсодержащий газ предварительно нагревают до температуры 600 720 °C, при этом получают смесь карбида W₂C и вольфрама.
 - 27. Способ по п. 15, отличающийся тем, что процесс ведут при соотношении углеродсодержащего газа к водороду 0,60-0,65, гексафторида вольфрама к

водороду 0,055 - 0,070, углеродсодержащий газ предварительно нагревают до температуры 560 - 700 $^{\rm o}$ C, при этом получают смесь карбида ${
m W_3C}$ и вольфрама.

- 5 28. Способ по п. 15, отличающийся тем, что процесс ведут при соотношении углеродсодержащего газа к водороду 0,20-0,35, гексафторида вольфрама к водороду 0,045 0,070, углеродсодержащий газ предварительно нагревают до температуры 500 680 $^{\circ}$ C, при этом получают смесь карбида W_{12} C и вольфрама.
- 29. Способ по п. 15, отличающийся тем, что процесс ведут при соотношении углеродсодержащего газа к водороду 0,35-0,60, гексафторида вольфрама к водороду 0,05 0,07, углеродсодержащий газ предварительно нагревают до температуры 500 680 °C, при этом получают смесь карбидов W₃C, W₁₂C и вольфрама.
 - 30. Способ по п. 15, отличающийся тем, что процесс ведут при соотношении углеродсодержащего газа к водороду 1,50-1,70, гексафторида вольфрама к водороду 0,10 0,12, углеродсодержащий газ предварительно нагревают до температуры 750 850 °C, при этом получают смесь карбида WC и углерода.
 - 31. Способ нанесения на подложки, преимущественно на конструкционные материалы и изделия из них, покрытия, включающего в себя внутренний слой вольфрама и внешний слой, содержащий субкарбид вольфрама $W_{12}C$,
- 25 отличающийся тем, что он включает в себя следующие стадии:
 - а) помещение подложки в реактор химического газофазного осаждения,
 - б) вакуумирование реактора,
 - в) нагрев указанной подложки,
- 30 г) подачу в реактор гексафторида вольфрама и водорода,

- д) выдерживание подложки в указанной газовой среде в течение времени, необходимого для образования на подложке слоя вольфрама,
- е) подачу в реактор дополнительно к указанным гексафториду вольфрама
 и водороду углеродсодержащего газа, причем углеродсодержащий газ
 5 предварительно термически активируют,
 - ж) выдерживание подложки в газовой среде, образованной на стадии е) в течение времени, необходимого для образования на подложке внешнего слоя, содержащего карбиды вольфрама или их смеси между собой, с вольфрамом или свободным углеродом.

32. Способ по п. 31, отличающийся тем, что процесс ведут при давлении в реакторе 2-150 кПА, температуре подложки 400-900 ^оС, соотношении углеродсодержащего газа к водороду 0,2-1,7, соотношении гексафторида вольфрама к водороду 0,02-0,12.

15

10

33. Способ по п. 31, отличающийся тем, что перед нанесением покрытия на материалы или изделили из помины. включающей железо, углеродистые стали, нержавеющие стали, чугуны, титановые сплавы, титаносодержащие твердые сплавы, на них наносят покрытие из материалов, химически стойких во фтористом водороде, в частности, никеля, кобальта, меди, серебра, золота, платины, иридия, тантала, молибдена, их сплавов, соединений и смесей путем электрохимического или химического осаждения из водных растворов, электролиза расплавов, физического и химического газофазного осаждения.

25

34. Способ по п. 32, отличающийся тем, что процесс ведут при соотношении углеродсодержащего газа к водороду 1,00-1,50, гексафторида вольфрама к водороду 0,08-0,10, углеродсодержащий газ предварительно нагревают до температуры 750-850 °C, при этом получают внешний слой, содержащий мнокарбид вольфрама WC.

- 35. Способ по п. 32, отличающийся тем, что процесс ведут при соотношении углеродсодержащего газа к водороду 0,75-0,90, гексафторида вольфрама к водороду 0,06-0,08, углеродсодержащий газ предварительно нагревают до температуры $600\text{-}750^{\circ}\text{C}$, при этом получают внешний слой, содержащий полукарбид вольфрама $W_2\text{C}$.
- 36. Способ по п. 32, отличающийся тем, что процесс ведут при соотношении углеродсодержащего газа к водороду 0,60-0,65, гексафторида вольфрама к водороду 0,050-0,055, углеродсодержащий газ предварительно нагревают до температуры 560-720°C, при этом получают внешний слой, содержащий субкарбид вольфрама W₃C.
 - 37. Способ по п. 32, отличающийся тем, что процесс ведут при соотношении углеродсодержащего газа к водороду 0,35-0,40, гексафторида вольфрама к водороду 0,040-0,045, углеродсодержащий газ предварительно нагревают до температуры 500-700 $^{\circ}$ С, при этом получают внешний слой, содержащий субкарбид вольфрама W_{12} С.
- 38. Способ по п. 32, отличающийся тем, что процесс ведут при соотношении углеродсодержащего газа к водороду 0,90-1,00, гексафторида вольфрама к водороду 0,07-0,09, углеродсодержащий газ предварительно нагревают до температуры 670-790°C, при этом получают внешний слой, содержащий смесь карбидов WC с W_2 C.
- 25 ` 39. Способ по п. 32, отличающийся тем, что процесс ведут при соотношении углеродсодержащего газа к водороду 0,70-0,75, гексафторида вольфрама к водороду 0,055-0,060, углеродсодержащий газ предварительно нагревают до температуры $580\text{-}730^{\circ}\text{C}$, при этом получают внешний слой, содержащий смесь карбидов $W_2\text{C}$ с $W_3\text{C}$.

- 40. Способ по п. 32, отличающийся тем, что процесс ведут при соотношении углеродсодержащего газа к водороду 0,65-0,70, гексафторида вольфрама к водороду 0,045-0,060, углеродсодержащий газ предварительно нагревают до температуры 570-710 $^{\circ}$ C, при этом получают внешний слой, содержащий смесь карбидов W_2 C, W_3 C и W_{12} C.
- 41. Способ по п. 32, отличающийся тем, что процесс ведут при соотношении углеродсодержащего газа к водороду 0,60-0,65, гексафторида вольфрама к водороду 0,045-0,060, углеродсодержащий газ предварительно нагревают до температуры 570-700°C, при этом получают внешний слой, содержащий смесь карбидов W_2 C и W_{12} C.
 - 42. Способ по п. 32, отличающийся тем, что процесс ведут при соотношении углеродсодержащего газа к водороду 0,40-0,60, гексафторида вольфрама к водороду 0,045-0,050, углеродсодержащий газ предварительно нагревают до температуры 550-680°C, при этом получают внешний слой, содержащий смесь карбидов W₃C и W₁₂C.
- 43. Способ по п. 32, отличающийся тем, что процесс ведут при соотношении углеродсодержащего газа к водороду 0,70-0,90, гексафторида вольфрама к водороду 0,08-0,09, углеродсодержащий газ предварительно нагревают до температуры 600-720°C, при этом получают внешний слой, содержащий смесь карбида W₂C с вольфрамом.
- 25 44. Способ по п. 32, отличающийся тем, что процесс ведут при соотношении углеродсодержащего газа к водороду 0,60-0,65, гексафторида вольфрама к водороду 0,055-0,070, углеродсодержащий газ предварительно нагревают до температуры 560-700°С, при этом получают внешний слой, содержащий смесь карбида W₃C с вольфрамом.

- 45. Способ по п. 32, отличающийся тем, что процесс ведут при соотношении углеродсодержащего газа к водороду 0,35-0,60, гексафторида вольфрама к водороду 0,050-0,070, углеродсодержащий газ предварительно нагревают до температуры 500-690°C, при этом получают внешний слой, содержащий смесь карбидов W₃C и W₁₂C с вольфрамом.
- 46. Способ по п. 32, отличающийся тем, что процесс ведут при соотношении углеродсодержащего газа к водороду 0,20-0,35, гексафторида вольфрама к водороду 0,045-0,070, углеродсодержащий газ предварительно нагревают до температуры 500-680 $^{\rm o}$ C, при этом получают внешний слой, содержащий смесь карбида W_{12} C с вольфрамом.
- 47. Способ по п. 32, отличающийся тем, что процесс ведут при соотношении углеродсодержащего газа к водороду 0,70-0,90, гексафторида вольфрама к водороду 0,08-0,09, углеродсодержащий газ предварительно нагревают до температуры 600-720°С, при этом получают внешний слой, содержащий смесь карбида WC с вольфрамом.
- 48. Способ по любому из пунктов 31-47, отличающийся тем, что покрытия 20 наносят на узлы трения.
 - 49. Способ по любому из пунктов 31-47, отличающийся тем, что покрытия наносят на формующий инструмент для обработки материалов давлением.
- 25 50 Способ по любому из пунктов 31-47, отличающийся тем, что покрытия наносят на узлы машин и механизмов, работающих со сжатыми газами и жидкостями или иных пневмогидравлических систем.
 - 51. Материал, включающий:

30 - подложку из конструкционного материала;

- нанесенное на указанную подложку покрытие, причем покрытие включает внутренний слой, выполненный из вольфрама, и внешний слой, содержащий карбид вольфрама, легированный фтором в количестве от 0,0005 до 0,5 вес.
 % и ,возможно, фторуглеродными композициями с содержанием углерода до
 15 вес % и фтора до 0,5 вес. %.
 - 52. Материал по п. 51, у которого карбид вольфрама представляет собой монокарбид WC.
- 10 53. Материал по п. 51, у которого карбид вольфрама представляет собой полукарбид W_2C .
 - 54. Материал по п. 51, у которого карбид вольфрама представляет собой субкарбид W_3C .
 - 55. Материал по п. 51, у которого карбид вольфрама представляет собой сумовканию обража образова образова обража обража образова образова
 - 56. Материал, включающий:
- 20 подложку из конструкционного материала,
 - нанесенное на указанную подложку покрытие, причем покрытие включает внутренний слой из вольфрама и внешний слой, содержащий смесь по меньшей мере двух карбидов вольфрама, легированных фтором в количестве от 0,0005 до 0,5 вес. % и, возможно, фторуглеродными композициями с содержанием углерода до 15 вес. % и фтора до 0,5 вес %.
 - 57. Материал по п. 56, отличающийся тем, что внешний слой содержит смесь карбидов вольфрама WC и W_{12} C.
- 58. Материал по п. 56, отличающийся тем, что внешний слой содержит смесь карбидов вольфрама W_3C и W_2C .

25

- 59. Материал по п. 56, отличающийся тем, что внешний слой содержит смесь карбидов вольфрама W_3C и $W_{12}C$.
- 60. Материал по п. 56, отличающийся тем, что внешний слой содержит смесь 5 карбидов вольфрама W_2C и $W_{12}C$.
 - 61. Материал по п. 56, отличающийся тем, что внешний слой содержит смесь карбидов вольфрама W_2C , W_3C и $W_{12}C$.
- 10 62. Материал по пп. 52-61, отличающийся тем, что внешний слой дополнительно содержит вольфрам.
 - 63. Материал по пп. 52-61, отличающийся тем, что внешний слой дополнительно содержит углерод.
 - 64. Материал по пп. 52-63, отличающийся тем, что внутренний слой имеет толщину 0,5-300 мкм при соотношении толщины внутреннего и внешнего слоев от 1:1 до 1:600.
- 20 65. Материал по пп. 52-64, отличающийся тем, что внешний слой подложки содержит сплавы с содержанием никеля выше 25 эт. %, например, инвар, нихром, монэль.
 - 66. Материал, полученный способом по любому из пп. 31-47.
 - 67. Многослойное покрытие, выполненное из чередующихся слоев вольфрама и слоев, содержащих карбид вольфрама в соответствии с пп. 1 6,.

- 68. Многослойное покрытие, выполненное из чередующихся слоев вольфрама и слоев, содержащий смесь карбидов вольфрама в соответствии с п.7.
- 69. Многослойное покрытие по пп.67-68, отличающееся тем, что отдельные его слои имеют толщину от 2 до 10 мкм при соотношении толщины чередующихся слоев от 1:1 до 1:5.
- 70. Способ нанесения на подложки, преимущественно на конструкционные материалы и изделия из них, многослойного покрытия в виде чередующихся слоев вольфрама и слоев, содержащих карбид вольфрама, или их смеси между собой, с вольфрамом или свободным углеродом, включающий в себя следующие стадии:
 - а) помещение подложки в реактор химического газофазного осаждения,
- (5 б) вакуумирование реактора,
 - в) нагрев указанной подложки,

- д) выдерживание подложки в указанной газовой среде в течение времени, необходимого для образования на подложке слоя вольфрама,
- 20 е) подачу в реактор дополнительно к указанным гексафториду вольфрама
 и водороду углеродсодержащего газа, причем углеродсодержащий газ
 предварительно термически активируют,
 - ж) выдерживание подложки в газовой среде, образованной на стадии е) в течение времени, необходимого для образования на подложке слоя, содержащего карбид вольфрама или смеси карбидов вольфрама между собой, с вольфрамом и углеродом, причем стадии г-ж) повторяют многократно для образования чередующихся слоев вольфрама и слоев, содержащих карбиды вольфрама.
- 30 71. Способ по п. 70, отличающийся тем, что процесс ведут при давлении в реакторе 2-150 кПА, температуре подложки 400-900 °C, соотношении

углеродсодержащего газа к водороду 0,2-1,7, соотношении гексафторида вольфрама к водороду 0,02-0,12.

- 72. Способ по п. 70, отличающийся тем, что перед нанесением покрытия на материалы или изделия из материалов, выбранных из группы, включающей железо, углеродистые стали, нержавеющие стали, чугуны, титановые сплавы, титаносодержащие твердые сплавы, на них наносят покрытие из материалов, химически стойких во фтористом водороде, в частности, никеля, кобальта, меди, серебра, золота, платины, иридия, тантала, молибдена, их сплавов, соединений и смесей путем электрохимического или химического осаждения из водных растворов, электролиза расплавов, физического и химического газофазного осаждения.
- 73. Способ по любому из пунктов 70-72, отличающийся тем, что покрытие 15 наносят на узлы трения.
 - 74. Способ по любому из пп. 70-72, отличающийся тем, что покрытие наносят на формующий инструмент для обработки металлов давлением.
- 20 75. Способ по любому из пп. 70-72, отличающийся тем, что покрытие наносят на узлы машин и механизмов, работающих со сжатыми газами и жидкостями или иных пневмогидравлических систем.
- 76. Конструкционный материал, включающий подложку и многслойное покрытие, выполненное из чередующихся слоев вольфрама и слоев, содержащих карбид вольфрама, легированный фтором в количестве от 0,0005 до 0,5 вес. % и, возможно, фторуглеродными композициями с содержанием углерода до 15 вес. % и фтора до 0,5 вес. %.
- 77. Материал по п. 76, у которого карбид вольфрама представляет собой монокарбид вольфрама WC.

- 78. Материал по п. 76, у которого карбид вольфрама представляет собой полукарбид вольфрама W_2C .
- 79. Материал по п. 76, у которого карбид вольфрама представляет собой 5 субкарбид вольфрама W_3C .
 - 80. Материал по п. 76, у которого карбид вольфрама представляет собой субкарбид вольфрама $W_{12}C$.
- 81. Конструкционный материал, включающий подложку и многослойное покрытие, выполненное из чередующихся слоев вольфрама и слоев, содержащих смесь по меньшей мере двух карбидов вольфрама, легированных фтором в количестве от 0,0005 до 0,5 вес. % и, возможно, фторуглеродными композициями с содержанием углерода до 15 вес. % и фтора до 0,5 вес %.
 - 82. Минисримы по то пом, у монтороно маронизмо селом селом солем маронизмо маронизмо селом с
- 20 83. Материал по по π .81, у которого карбидные слои содержат смесь карбидов вольфрама W_2C и W_3C .
 - 84. Материал по по п.81, у которого карбидные слои содержат смесь карбидов вольфрама W_3C и $W_{12}C$.
 - 85. Материал по по п.81, у которого карбидные слои содержат смесь карбидов вольфрама W_2C и $W_{12}C$.
- 86. Материал по по п.81, у которого карбидные слои содержат смесь 30 карбидов вольфрама W_2C , W_3C и $W_{12}C$.

- 87. Материал по любому из пунктов 76-86, отличающийся тем, что карбидные слои дополнительно содержат вольфрам.
- 88. Материал по любому из пунктов 76-86, отличающийся тем, что карбидные слои дополнительно содержат углерод.
 - 89. Материал по любому из пунктов 76-88, отличающийся тем, что отдельные его слои имеют толщину от 2 до 10 мкм при соотношении толщины чередующихся слоев от 1:1 до 1:5.

90. Конструкционный материал, полученный способом по любому из пунктов 70-72.





INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No. PCT/RU 99/00037

IPC 7 C23C	FICATION OF SUBJECT MATTER C 16/32, C23C 16/452, B23B 15/00		
	International Patent Classification (IPC) or to both nat SEARCHED	ional classification and IPC	
Minimum do	cumentation searched (classification system followed by 16/30, 16/32, 16/44, 16/452, 30/00, B32B 15/00		
Documentation	on searched other than minimum documentation to the	extent that such documents are included	in the fields searched
Electronic dat	ta base consulted during the international search (name	of data base and, where practical, searc	h terms used)
C. DOCUM	ENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where ap	propriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	US 4980201 A (CENTRAL GLASS COMPAN 25 December 1990 (25.12.90), Abstract	IY, LIMITED)	1-19, 30-37
Α	US 5006371 A (AIR PRODUCTS AND CHEM 9 April 1991 (09.04.91), Abstract	IICALS, INC)	1-50, 56-76
Α	US 4874642 A (AIR PRODUCTS AND CHEM 17 October 1989 (17.10.89), Abstract	IICALS, INC)	1-90
A	JP 61157681 A (OYO KAGKU KENKYUSHO 17 July 1986 (17.07.86), Abstract Mirovoi patentny ukazatel [on-lain], London, V Publication, Ltd. [neideno 1999-21-09], Naiden France, DW8635, nomer Dostupa N° 86-228503	elikobritanya : Dervent o v : Questel-Orbit, Paris,	1-51
Α	JP 6108375 A (OYO KAGAKU KENKYUSHO 28 April 1996 (28.04.96), Abstract Mirovoi patentny ukazatel [on-lain], London, V Publication, Ltd. [neideno 1999-21-09], Naiden France, DW8623, nomer Dostupa N° 148318	elikobritanya : Dervent	8-66
X Furth	er documents are listed in the continuation of box C.	Patent family members are li	sted in annex.
* Special categories of cited documents: "A" document defining the general state of the art which is not considered to a forest pulse of		'T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention	
dered to be of particular relevance "E" earlier document but published on or after the international filing date		"X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone	
"L" document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)		"Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot beconsidered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art	
"O" document means	t referring to an oral disclosure, use, exhibition or other	"&" document member of the same paten	
	t published prior to the international filing date but later priority date claimed		
Date of the actual completion of the international search 23 September 1999 (23.09.99)		Date of mailing of the international se 7 October 1999 (07.10.99)	arch report
Name and ma	iling address of the ISA/ RU	Authorized officer	
		Telephone No.	





International application No. PCT/ RU 99/00037

	· PCI/ KU	77100031		
C. (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT				
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passag	es Relevant to claim No.		
A	DE 3907693 A (CENTRAL GLASS CO LTD) 5 July 1990 (05.07.90), Abstract Mirovoi patentny ukazatel [on-lain], London, Velikobritanya: Dervent Publication, Ltd. [neideno 1999-21-09], Naideno v: Questel-Orbit, Paris, France, DW8939, nomer Dostupa N° 89-279312	1-55		
A	JP 55024803 A (MITSUBISHI METAL CORP) 22 September 1980 (22.09.80), Abstract Mirovoi patentny ukazatel [on-lain], London, Velikobritanya: Dervent Publication, Ltd. [neideno 1999-21-09], Naideno v: Questel-Orbit, Paris, France, DW8014, nomer Dostupa N° 80-244226	8-90		
A	RU 2106429 C1 (RYZHENKOV VYACHESLAW ALEXEEVICH et al) 10 March 1998 (10.03.98), Abstact	8-55		
	·			

Form PCT/ISA/210 (continuation of second sheet) (July 1992)

Page 2 of 2

ОТНЕТ О МЕЖДУНАРОДНОМ ПОИСКЕ



A IZTI A CO	OHALIWA MIXA EDDEN ADD.			
A. KJIAC(СИФИКАЦИЯ ПРЕДМЕТА ИЗОБРЕТЕН			
Commercia		C23C 16/32, C23C 16/452, B23B 1	5/00	
	іеждународной патентной классификации (МП СТИ ПОИСКА:	IK-7)		
) ACTIVITY		
	ый минимум документации (система классифи 6/30, 16/32, 16/44, 16/452, 30/00, B32B 15.			
C25C 1	0/30, 10/32, 10/44, 10/432, 30/00, B32B 13/	700		
Другая про	веренная документация в той мере, в какой он	а включена в поисковые подборки:		
Электронна	ая база данных, использовавшаяся при поиске	(название базы и, если, возможно, поис	сковые термины):	
С. ДОКУЛ	НЕНТЫ, СЧИТАЮЩИЕСЯ РЕЛЕВАНТН	ными:		
Категория*	Ссылки на документы с указанием, где это	возможно, релевантных частей	Относится к пункту М	
Α	US 4980201 A (CENTRAL GLASS COMPAN	NY, LIMITED) Dec. 25, 1990, реферат	1-19, 30-37	
Α	US 5006371 A (AIR PRODUCTS AND CHEN	MICALS, INC.) Apr. 9, 1991, реферат	1-50, 56-76	
Α	US 4874642 A (AIR PRODUCTS AND CHEM	MICALS, INC.) Oct. 17, 1989, реферат	1-90	
A	JP 61157681 A (OYO KAGAKU KENKYUSF Мировой патентный указатель[он-лайн], Лог Publication, Ltd. [найдено 1999-21-09], Найд Франция, DW8635, номер доступа № 86-228	ндон, Великобритания: Dervent teнo в: Questel-Orbit, Париж,	1-51	
A	JP 61084375 A (OYO KAGAKU KENKYUSHO ZH et al) 28.04.1996, реферат, Мировой патентный указатель[он-лайн], Лондон, Великобритания: Dervent Publication, Ltd. [найдено 1999-21-09], Найдено в: Questel-Orbit, Париж, Франция, DW8623, номер доступа № 86-148318		8-66	
\mathbf{X} последук	ощие документы указаны в продолжении графы С.	данные о патентах-аналогах указаны	в приложении	
• Особые кате	горин ссылочных документов:	Т более поздний документ, опубликованный пос		
	определяющий общий уровень техники	приоритета и приведенный для понимания из	-	
	ий документ, но опубликованный на дату родной подачи или после нее		т, имеющий наиболее близкое отношение к предмету	
	относящийся к устному раскрытию, экспони-	 тойска, порочащий новизну и изооретательск. У документ, порочащий изобретательский уровен 	поиска, порочащий новизну и изобретательский уровень	
рованию	и т.д.	тании с одним или несколькими документамі		
Р документ, с	опубликованный до даты международной по-	категории	i ion ko	
дачи, но	после даты испрашиваемого приоритета	& документ, являющийся патентом-аналогом		
н	т.д.			
Дата действ	вительного завершения международного	Дата отправки настоящего отчета о ме	жилнаролном поиске.	
поиска	23 сентября 1999 (23.09.99)	07 октября 1999 (07.10.99		
Наименова	ние и адрес Международного поискового органа:	Уполномоченное лицо:	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Федера	льный институт промышленной			
собстве		И. Пойменов	за	
_	21858, Москва, Бережковская наб., 30-1			
Факс: 243	3-3337, телетайп: 114818 ПОДАЧА	Телефон № (095)240-25-91		



Меж рдная заявка № РСТ/RU 99/00037

Категория	тжение), ДОКУМЕНТЫ, СЧИТАЮЩИЕСЯ РЕЛЕВАНТНЫМИ Ссылки на документы с указанием, где это возможно, релевантных частей	Относится к пункту №
A	DE 3907693 A (CENTRAL GLASS CO LTD) 05.07.1990, реферат,	1-55
	Мировой патентный указатель[он-лайн], Лондон, Великобритания: Dervent	
	Publication, Ltd. [найдено 1999-21-09], Найдено в: Questel-Orbit, Париж,	
	Франция, DW8939, номер доступа № 89-279312	
Α	JP 55024803 A (MITSUBISHI METAL CORP) 22.09.1980, реферат,	8-90
	Мировой патентный указатель[он-лайн], Лондон, Великобритания: Dervent	
	Publication, Ltd. [найдено 1999-21-09], Найдено в: Questel-Orbit, Париж,	
	Франция, DW8014, номер доступа № 80-244226	
Α	RU 2106429 C1 (РЫЖЕНКОВ ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСЕЕВИЧ и др.) 10.03.98	8-55
	реферат	6-55
0.		
		4.48
i		
-		
	·	
ļ		
ŀ		
	·	
		Ī

Форма РСТ/ISA/210 (продолжение второго листа)(июль 1998)